イオンプレーティング装置 IC-1500

イオンプレーティング装置IC-1500は、油回転ポンプ・油拡散ポンプ・液体窒素トラップの排気系で構成され、粗引開始後5分で×10^{-4}Pa台まで到達します。EB方式により、あらゆる誘電体や金属の成膜に対応することが可能です。また直流安定化電源(バイアス用)、加熱機構、水晶式膜厚計も標準搭載しておりますので、より密着性の高い膜＆膜厚精度の高い膜を成形することも可能です。

イオンプレーティング装置 IC-1500 仕様

○到達圧力	×10^{-5}Pa台※常温・無負荷・脱ガス完了時
○排気速度	×10^{-4}Pa台迄本引開始後5分以内※常温・無負荷・脱ガス完了・液体窒素使用時
○真空室径	φ500mm×650mmH SUS304 電解研磨
○蒸着機構	電子衝撃方式(EB方式)
	電子銃最大投入電力:5kW
	ルツボ容量:2.9mL
	ルツボ個数:4個
	ビーム偏向角:225°
	電源出力電圧:DC-4～-10kV
	電源出力電流:DC0～500mA
○基板回転	モーター直接駆動方式
	回転数:0～40rpm
○基板加熱	ハロゲンランプ1.5kW×2式
	常温～300℃迄昇温可能
	制御方式:サイリスタ制御・PID方式デジタル温調計
○膜 厚 計	水晶振動式膜厚計
○真空排気系	油回転ポンプ:1200L/min[60Hz]
	油拡散ポンプ:3000L/sec
○真 空 計	大気圧検知器/ピラニ真空計/メタル電離真空計
○バイアス機構	DC0～-1kV DC0～0.5A 直流安定化電源 1台
○プラズマ機構	RF電源 13.56MHz 600W 自動マッチング 1台
○操作方法	自動/手動選択可能
○ガス機構	マスフローコントローラ×1式
○ユーティリティ	電気:AC200V三相15kVA
	冷却水:17L/min以上0.1MPa以上0.15MPa以下25℃以下循環
	圧縮空気:0.5MPa以上

＜製造・販売元＞株式会社サンバック 〒135-0002 東京都江東区住吉1-19-1ツインタワーすみとし住吉館205号
TEL:03-3635-1701(代) FAX:03-3635-1705 URL:http://www.sanvac.com/ E-mail:info@sanvac.com